

МГД СТАБИЛИЗАЦИЯ ПЛАЗМЫ В АКСИАЛЬНО-СИММЕТРИЧНОЙ ОТКРЫТОЙ ЛОВУШКЕ

В.В.Арсенин

Указан класс простых ловушек, в которых при соединении с тонкой ловушкой, имеющей кривизну другого знака, возможна МГД устойчивость плазмы низкого давления.

1. В аксиально-симметричных ловушках простейшего типа (с рабочим магнитным потоком, заключенным между катушками и осью) плазма с естественным, спадающим к пробкам распределением давления подвержена желобковой магнитогидродинамической неустойчивости ¹. Обнаруженный недавно ² пример пробкотрона, устойчивого относительно крупномасштабных желобковых возмущений, указывает на существование ловушек этого типа, в которых при соединении с элементом с противоположным знаком кривизны силовых линий достигается устойчивость относительно всех мод. Ниже найден класс ловушек, обладающих этим свойством. Для максимального упрощения рассматривается случай сильной анизотропии, когда поперечное давление p_{\perp} много больше продольного p_{\parallel} (малое пробочное отношение или дискообразная плазма около минимума поля).

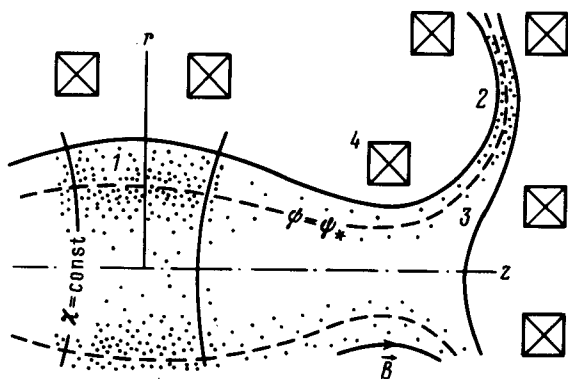


Схема конфигурации: 1 – основная ловушка, 2 – компенсирующая ловушка, 3 – соединительная плазма, 4 – катушки с током

2. Магнитная конфигурация показана на рисунке. Предполагается, что ловушки 1, 2 соединены плазмой, давление которой пренебрежимо мало, но проводимость высока, так что желобковое возмущение охватывает плазму по всей силовой линии. Пусть 1) ячейка 2 тонкая: $|\partial \ln B / \partial \ln p| \ll 1$ (удалена от оси и/или имеет сильное поле); 2) в ловушке 1 анизотропия велика и относительное изменение вдоль поля величины $\partial B / \partial \psi$, где ψ – отсчитываемая от оси потоковая координата, меньше или порядка $p_{\parallel} / p_{\perp}$ (это возможно, например, если данная ловушка имеет экваториальную плоскость симметрии; заметим, что мы пока не требуем, чтобы ловушка относилась к простейшему типу). Тогда критерий МГД устойчивости Крускала – Обермана ³ для плазмы низкого ($\beta = 8\pi(p_{\perp} + p_{\parallel})/B^2 \ll 1$) давления принимает

$$W_1 + W_2 > 0, \tag{1}$$

где

$$W_1 = \int \left[- \frac{\partial}{\partial \psi} \left(\frac{p_{\perp} + p_{\parallel}}{B^2} \right) \frac{\partial B}{\partial \psi} + \frac{p_{\perp} - p_{\parallel}}{B^3} \left(\frac{\partial B}{\partial \psi} \right)^2 \right] \frac{d\chi}{B}, \tag{2}$$

$$W_2 = - \int \frac{\partial(p_{\perp} + p_{\parallel})}{\partial \psi} \frac{\partial B}{\partial \psi} \frac{d\chi}{B^3}, \tag{3}$$

χ — продольная координата ($\nabla \chi = \mathbf{B}$), интегрирование в $W_{1,2}$ проводится по областям 1, 2 соответственно. Вводя α ($0 < \alpha < 1$) такое, что $(p_{\perp} - p_{\parallel})_1 \geq \alpha(p_{\perp} + p_{\parallel})_1$, получаем из (1) достаточное условие устойчивости

$$W = - \int \frac{\partial}{\partial \psi} \left(\frac{p}{B^{2+\alpha}} \right) \frac{\partial B}{\partial \psi} \frac{d\chi}{B^{1-\alpha}} > 0, \tag{4}$$

где $p = p_{\perp} + p_{\parallel}$, интегрирование ведется вдоль всей системы, и в области 2 в комбинации $\partial(p/B^{2+\alpha})/\partial\psi$ существенна лишь $\partial p/\partial\psi$. При $\alpha \rightarrow 0$ (т.е. без учета положительного второго слагаемого в (3)) (4) переходит в достаточное условие, приведенное в ⁴.

Пусть плазма занимает слой около поверхности $\psi = \psi_*$ и в нем $(\psi - \psi_*)\partial(p/B^{2+\alpha})/\partial\psi \leq \leq 0$). При этом (4) удовлетворяется, если отношение давлений в ловушках 1, 2 таково, что на всех силовых линиях, проходящих через плазму,

$$\int \left(\frac{1}{B^{1-\alpha}} \frac{\partial B}{\partial \psi} \right)_{\psi = \psi_*} \frac{p}{B^{2+\alpha}} d\chi = 0, \tag{5}$$

и в ловушке 1 в данном слое

$$\frac{\partial}{\partial \psi} \left(\frac{1}{B^{1-\alpha}} \frac{\partial B}{\partial \psi} \right) > 0. \tag{6}$$

Если плазма в элементе 1 находится около экваториальной плоскости симметрии, то (6) можно записать как

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{B^{2-\alpha} r} \frac{\partial B}{\partial r} \right) > 0. \tag{7}$$

Условие (6) выражается через характеристики силовой линии:

$$\frac{d''}{d} + \frac{k}{r} \cos \theta + \alpha k^2 > 0. \tag{8}$$

Здесь $r(s)$ — расстояние до оси, $k(s)$ — кривизна, $\theta(s)$ — угол между нормалью к поверхности $\psi = \text{const}$ и радиальным направлением, s — длина вдоль силовой линии, $d = r^{-1}(s)B^{-1}(s)$ имеет смысл толщины силовой трубки с единичным потоком, штрих означает производную по s . Отдельные слагаемые в левой части (8) просто интерпретируются. При компенсации средних кривизн (равенство (5)) стабилизация за счет $d'' > 0$ обязана действию "скрытой" (на фоне общего изгибания) вогнутости силовой трубки. Происхождение $k \cos \theta / r$ связано с тем, что величина $\partial B / \partial \psi = -k/r$ в (6) содержит не только кривизну, но и радиальную координату, так что при не зависящей от ψ кривизне производная $\partial B / \partial \psi$ растет с увеличением ψ , поскольку r растет с ψ . Квадратичный по k член описывает влияние большой кривизны магнитного поля.

3. Конкретизируем условие (6) для интересующего нас случая, когда ячейка 1 представляет собой ловушку простейшего типа, см. п. 1. Векторный потенциал поля в такой ловушке определяется одной функцией $b(z)$ — полем на оси:

$$A_{\varphi} = \frac{b(z)}{2} r - \frac{b''}{16} r^3 + \frac{b^{IV}}{384} r^5 - \dots, \tag{9}$$

¹⁾ Заметим, что допустимы и профили с отличным от нуля давлением на оси.

причем для продольного удержания нужно, чтобы $b(z)$ имела минимум между пробками, скажем при $z = 0$. Рассмотрим ради простоты записи случай экваториальной симметрии и ограничимся выписанными членами разложения (9). При этом (7) сводится к

$$b^{IV}(0) > 4 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \frac{(b''(0))^2}{b(0)}. \quad (10)$$

Отметим, что, согласно (10), стабилизация не требует большой кривизны и возможна и в приосевой области. Условие (6) на $B^{\alpha-1} \partial B / \partial \psi$ мягче неравенства $\partial(\psi B^{\alpha-1} \partial B / \partial \psi) / \partial \psi > 0$, выполнение которого обеспечивало бы (аналогично ²) подавление первой моды в системе с анизотропной плазмой без компенсирующей ловушки 2.

При компенсации общей кривизны, то-есть занулении вклада в W от старшего, не зависящего от ψ члена в $\partial B / \partial \psi$, неравенство (10), а в общем случае (6), обеспечивает среднюю магнитную яму, поскольку производная $\partial^2 B / \partial \psi^2 > (1 - \alpha) B^{-1} (\partial B / \partial \psi)^2$ положительна.

Литература

1. Rosenbluth M.N., Longmire C. Ann. Phys., 1957, 1, 120.
2. Рютов Д.Д., Ступаков Г.В. Письма в ЖЭТФ, 1985, 42, 29.
3. Kruskal M.D., Oberman C.R. Phys. Fluids, 1958, 1, 275.
4. Арсенин В.В. Письма в ЖЭТФ, 1983, 37, 534.

Поступила в редакцию

27 января 1986 г.